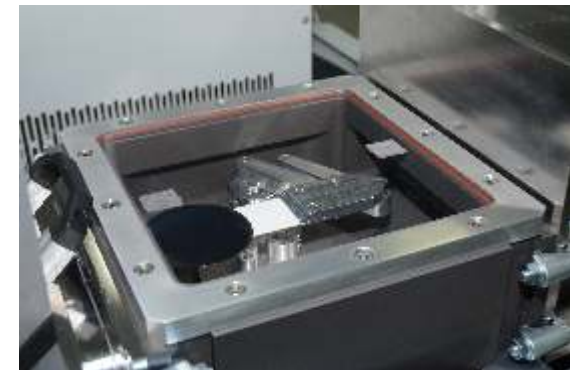


# ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА РЕАКТИВНО-ИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ СЛОЕВ СО ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ ИЗ КАССЕТЫ В КАССЕТУ

## ПЛАЗМА ТМ 7

**Назначение:** Травление диэлектрических слоев и полупроводниковых материалов методом реактивно-ионного травления.



### Особенности:

- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек  $\varnothing$  76, 100, 150 мм из кассеты в кассету;
- Транспортная система переноса подложек из шлюзовой камеры в рабочую камеру на основе манипулятора;
- Измерение ВЧ смещения на ВЧ электроде – подложкодержателя в диапазоне от 0 до 1000В;
- Рабочие газы: Ar, He, CF<sub>4</sub>, SF<sub>6</sub>, C<sub>3</sub>F<sub>8</sub>, CHF<sub>3</sub> и др.;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ электрода-подложкодержателя в диапазоне 50-400 Вт;
- Мощность потребления не более 6,5 кВт;
- Безмасляная система откачки;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

